⑩ 公開特許公報(A) 昭

昭62 - 148346

@Int_Cl_4	識別記号	庁内整理番号		43公開	昭和62年(198	7)7月2日
C 03 C 25/02 C 08 F 279/02	MQP	A-8017-4G 6681-4J					
C 08 K 5/11 C 08 L 71/02	LQE	8016-4J					
C 09 D 5/00 G 02 B 6/44	102	M-7370-2H	審査請求	未請求	発明の数	1	(全11頁)

母発明の名称 光学ガラスファイバ被覆用材料

②特 願 昭60-286162

突出 願 昭60(1985)12月19日

砂発明者下飼 勝次郎 千葉市都町1061-14

⑪出 顋 人 日本曹達株式会社 東京都千代田区大手町2丁目2番1号

郊代 理 人 弁理士 横山 吉美

明 細 書

1. 発明の名称

光学ガラスファイバ被預用材料

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) (A) 重合性不飽和結合を有する数平均分子 量300~6,000の液状ジェン系重合 体、
 - (B) エーテル結合、エステル結合およびジェン結合よりなる群から選ばれた結合を有し、かつ分子内にケイ皮酸基を有する 数平均分子量300~8.000の重合体、
 - (C) アクリロイル基またはメタクリロイル 基を有する化合物、および
 - (D) 光重合開始剂

上記成分 (A)、(B)、(C) および (D) を含有してなることを特徴とする光 学ガラスファイバ被覆用材料。

(2) (A) 、 (B) 、 (C) および (D) 成分の

配合比率が、(A) 100重量部、(B) 2~180重量部、(C) 5~300重量 部であり、(D) が(A)、(B) および(C) の総量に対して0.01~20重量 %である特許請求の範囲第(1)項記載の光学ガラスファイバ被獲用材料。

3: 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は光伝送用の光学ガラスファイバ被覆 用材料に関する。

(従来の技術)

一般に光伝送用媒体として使用される光学ガラスファイバは材質的には非常に脆く、傷つき易く、かつ汚染によって光伝送損失が大きくなる。

このため従来、光ファイバのガラス母材からの訪糸直後、光ファイバの表面を樹脂で被**買する**ことが行われている。このため熱硬化性のエポキシ樹脂やウレタン樹脂が用いられてきているが、これらは硬化時間が長く、ガラスファイバとの密

着性が不足し、柔軟性、特に低温下での柔軟性に 欠除しているためにマイクロベンデングによる伝 送損失が増大し、長期の使用に於いて信頼できる ものではなかった。

このため、今日では引張り弾性率、ガラス転移点が低く、伝送損失の優れているシリコン樹脂が専ら使用されてきているが、熱硬化性樹脂であるため硬化性が悪く、生産速度が遅いこと、価格が高い等の欠点がある。

近年、光ファイバの低価格化のためにシリコン樹脂の代わりとして種々の被覆材が提案されている。例えば、紫外線硬化型のエポキシアクリレート並びにウレタンアクリレート等の材料が提案されているが、これらの材料はシリコン樹脂に較べてガラス転移温度が比較的に高いことから低温での引張り弾性率が高く、これら材料で被覆した光ファイバはマイクロベンデング等による伝送損失が高い欠点がある。

最近に至り官能基を有する熱硬化性 1,4ーポ

柔軟性および低温・高温特性等が低下すると共に 紫外線硬化速度等の硬化性も低下するという欠点 が生する。一方、経時的に引張り弾性率の増加を 解消する方法として酸化防止剤を配合する方法が 提案されている(特開昭 5 9 - 2 0 8 5 0 5)が 必ずしも十分に効果を発揮するには至っていない。

このため、 1.4-ポリブタジエン類を用いた 被覆材料は被覆光ファイバの高張力のプルーフテ ストを行う段階で強度劣化や伝送損失を生じると いう問題をかかえている。

(発明が解決しようとする問題点)

ポリプタジェン類を主成分とする被覆材はエポキシ樹脂、ウレタン樹脂系の被覆材と較べてが ラス転移温度が低いため、これを用いて被覆して えられた光ファイバは低温においても安定した伝 送特性を有しているためこれを光ファイバ被覆材 に使用する研究が活発に行われている。

しかし、一次被照材料と接街層の両機能を持たせるにはポリプタジエン類を主成分とする被覆

リプタジェン類あるいは重合性不飽和結合を導入した 1.4~ポリプクジェン類の被理材料が提案されてきている(特開昭 5 8 ~ 7 1 0 3)。この樹脂はエポキシ樹脂、ウレタン樹脂系に較べてガラス転移温度が低いため、これを用いて被理した光ファイバは低温においても優れた伝送特性を有している。

しかるに、 1,4~ポリブタジエン類を用いた 被覆材料は粘度が高く、高速作業性が悪いこと、 石英ファイバに対して密着性が悪いこと、さらに 高温に曝された場合に網状化が進み引張り弾性率 が増大する傾向がある。このため、これら材料で 被覆した光ファイバは経時的に伝送損失が増加す るという欠点がある。

このような欠点を解消する方法として、粘度 を低下させるために可塑剤を用いたり、反応性希 収剤を用いることにより作業性を向上させる方法 が提案されている(特開昭 5 9 - 2 2 7 9 1 5) が、得られた硬化被膜の強度が著しく低下したり、

材の引張り弾性率は高く、これを低くする方策を 見い出すことが求められている。

現在、光ファイバの被覆構造は(a)タイト 構造素級では一次被覆と設街層の二層構造をとっ ているが、(b)ルーズ構造素級では一次被覆と 中空の二層構造がとられている。この被膜構造を 単純化し、これによって光ファイバの価格の低減 を計るにはタイト構造素線では一次被覆と緩街層 を一体化することである。

このためには従来のポリプクジェン類を主成分とする被覆材の引張り弾性を1.0以下、好ましくは0.1オーダにすることが強く求められている。また、ポリプクジェン類を主成分とする被覆材の引張り弾性率が熱的環境下に聴されることによって著しく増大し、光伝送損失が悪化する。

本発明はこれらの欠点を解消し、一次被覆と 提衝層の二層構造の両方の機能を一層被覆のみで 果たせる被覆材料を提供することにある。これに よって、光ファイバの素線の塗工作築が1回です み光学ガラスファイバ製造コストの過越をせんと するものである。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、下記成分:

- (A) 重合性不飽和結合を有する数平均分子 量300~6,000の液状ジェン系重合 体(以下(A)又は(A)重合体とい う)、
- (B) エーテル結合、エステル結合およびジェン結合よりなる群から選ばれた結合を有し、かつ分子内にケイ皮酸基を有する数平均分子量300~8.0000重合体(以下(B)又は(B)重合体という)、
- (C) アクリロイル基またはメタクリロイル 基を有する化合物 (以下 (C) 又は (C) 化合物という)、および
- (D) 光度合開始剂

上記成分 (A)、(B)、(C) および (D) を含有してなることを特徴とする光

アクリロイル基、メタクリロイル基、アクリルアミドアリル基、ビニルエーテル基、ビニルチオエーテル基、ビニルアミノ基などがあり、これらのうちでもアクリロイル基、メタクリロイル基、アクリルアミド、メタアクリルアミド基が硬化性の点から好ましい。

(A) 重合体を製造するには、各種の方法を 採用することができる。例えば(i) 結性水素基 含有液状ジエン系重合体にアクリル酸、メタアク リル酸、マレイン酸などの不飽和カルボン酸また はその誘導体(無水物など)を反応させる。(ii) 活性水素基合有液状ジエン系重合体にグリレート びルアクリレート、グリンジルメタアクリレト などを反応させる、(iii) 活性水素基合有液状ジェンメタアクリレト などを反応させる、(iii) にできる イソシアネート ではイソシアネート にさせる エン系重合体にイソシアネート にさせる エンアクリレートまたはイソシアルキルアクリレートまたはヒドロキシアルキルアクリレートまたはヒドロキシアルキルアクリレートまたはヒドロキシアルキルアクリレートまたはヒドロキシアルキルアクリレートまたはヒドロ 学ガラスファイバ用被覆材料である。 次に本発明を詳細に説明する。

本発明に用いられる(A) 重合体とは、1分子中に重合性不飽和結合を1.3~4個含有する数平均分子量が300~6.000の被状ジェン系重合体としては、炭素数4~14のジェン重合体、その共重合体、と炭素数4~14のジェンを検索数2~2400~14レフィン性付加重合性モノマーと皮素数2~2400~14レフィン性付加重合性モノマーとの共重体がある。具体的にはブタジェンホモポリマー、ブタジェンースチレンコポリマー、ブタジェンースチレンコポリマー、ブタジェンースチレンコポリマー、ブタジェンーを例示することができる。

また、ここでの重合性不飽和結合としては、 種々のものを使用することが可能である。例えば

キシアルキルメタアクリレートなどを反応させる、
(v) エポキシ基合有液状ジエン系重合体にアクリル酸、メタアクリル酸などを反応させる、(
n) 活性水素基合有液状ジエン系重合体とイソシアナートアルキルメクアクリレート、イソシアナート、プロペニルイソシアナートなどを反応させる方法により製造することができる。ここで用いる活性水素基合有液状ジエン系重合体としては、分子末端に水酸基、アミノ基、イミノ基、カルボキシル基、メルカプト基などの活性水素基を有する液状ジェン系重合体である。

(A) 重合体の数平均分子量が300未満では、光硬化で得られた被覆材料は固くて脆く、光学ガラスファイバ用被覆材料としては不適当となる。他方、数平均分子量が6,000を超えると被履材料の粘度が高く、光学ガラスファイバへの塗工が非常に困難となる。

また、(A)重合体中の重合性不飽和結合が

1分子中に1.3未満では、光硬化被覆材料の分子量の競長延長が低く、このため強効性に欠ける。 一方、4個を越えると架構度が高過ぎて柔軟性に欠ける。

本発明に用いられる (B) 重合体分子骨格中にエーテル結合、エステル結合またはジエン結合を有し、しかも活性水素を有する夫々の重合体にケイ皮酸基を導入して得られる。ここで含う分子骨格中にエーテル結合を有し、かつ活性水素を有する重合体としては、水または多価アルコールにエチレンオキサイド、プロピレンオキサイドよりなる群から選ばれた少なくとも1種を反応させて得られる通常のポリアルキレンエーテルポリオールおよびテトラメチレンフランの開理重合で得られるポリテトラメチレンエーテルグリコール類である。

ここでの多価アルコールとしては、エチレン グリコール、プロピレングリコール、ペンタング リコール、ヘキサングリコール、ヘキサンブチレ

多価アルコールとして、例えばエチレングリコール、プロピレングリコール、 1.4-ブタンジオール、 1.5-ベンタンジオール、 1.6-ヘキサンジオール、ピスー (ヒドロキシメチルクロルヘキサン)、ジエチレングリコール、ジプロピレングリコール、 1.2.6-ヘキサントリオール、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、ソルビトール、グリセリンまたは、これらに類する任意な多価アルコールを使用することができる。

ラクトン重合物とは、 ε ーカプロラクトン、 δ ーバレロラクトン、 ρ ーエナントラクトン等の ラクトンをグリコール等を開始剤として開環重合 で得られる。

また、ここで言う分子骨格中にジェン結合を 有し、しかも活性水衆を含有する重合体としては (A) 重合体を使用することができる。

次に、前記の (B) 重合体を製造するには、 各種の方法でもって製造することができる。 ングリコール、デカメデレングリコール、グリセリン、ジエチレングリコール、ジプロピレングリコール、ジグリセリン、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、 1,2,6 - ヘキサントリオール、ショ糖、ソルピトール、チオグリコールおよびトリエタノールアミン等が用いられる。

また、ここで言うエステル結合を有し、かつ活性水素を含有する重合体としては、ポリカルボン酸と多価アルコールとの縮合物、ヒドロキシカルボン酸と多価アルコールとの縮合物およびラククンム、ランクトン重合物等である。

また、前記のポリカルボン酸として、例えばベンゼントリカルボン酸、アジピン酸、琥珀酸、スペリン酸、セパチン酸、シュウ酸、メチルアジピン酸、グルタル酸、ピメリン酸、アゼライン酸、フタル酸、テレフタル酸、イソフタル酸、チオジプロピオン酸、マレイン酸、フマル酸、シトラコン酸、イタコン酸、ダイマー酸または、これらに類する任意なカルボン酸を使用することができる。

例えば (i) 分子骨格中にエーテル結合、エ ステル結合またはジエン結合を有する活性水素含 有重合体にケイ皮酸またはケイ皮酸クロライドを 反応させる、 (ji)分子骨格にエーテル結合、エ ステル結合およびジエン結合を有する活性水素含 有重合体にイソシアナート・ヒドロキシアルキル シンナマートなどを反応させる、(m)分子骨格 にエーテル結合、エステル結合およびジエン結合 を有する活性水素含有重合体にグリシジルシンナ マートなどを反応させる、(iv)分子骨格にエー テル結合、エステル結合およびジェン結合を有す るエポキシ基合有重合体にケイ皮酸などを反応さ せる、(v)分子骨格にエーテル結合、エステル 結合またはジェン結合を有すると活性水素含有瓜 合体とイソシアナート化合物の予重合体に2-ヒ ドロキシエチルシンナマートなどを反応させる方 法等によって製造することができる。ここで用い る分子骨格にエーテル結合、エステル結合または ジェン結合を有する活性水素含有重合体としては、 分子末端に水酸基、アミノ基、イミノ基、カルボ キシル基、メルカプト基などの活性水流基を有す る重合体を指す。

前述の知くにして得られた(B) 飲合体の数平均分子量は300~8.000である。数平均分子量が300未満では、光硬化で得られた被理材料の引張り弾性率が1.0以上と高くなり、外圧に対する接衝作用の能力低下をきたし好ましくない。逆に、数平均分子量が8.000を越えると光硬化の被理材料の表面に粘着性が残り二次被理材(ナイロン・被晶性ポリエステル等)の被理作業に支降をきたす。

次に、本発明に用いられる (C) 化合物とは、 具体的には単官能性化合物として、フェノキシ (メタ) アクリレート、 (メタ) アクリル酸ー 2 - エチルヘキシル、 (メタ) アクリル酸プチル、 (メタ) アクリル酸ドデシル、 (メタ) アクリル 酸の 2 - ブトキシエタノールあるいは 2 - エトキ シエクノールのエステル、テトラヒドロフルフリ

オペンチルグリコールジ (メタ) アクリレート、 エチレングリコールジ (メタ) アクリレート、ジ エチレングリコールジ (メタ) アクリレート、ト リエチレングリコールジ (メタ) アクリレート、 ポリエチレングリコールジ (メタ) アクリレート、 ポリプロピレングリコールジ (メタ) アクリレート、 ヒドロキシピバリン酸ネオペンチルグリコー ルジ (メタ) アクリレートなどが挙げられる。

また、必要に応じて前記 (C) 化合物と他の ビニル基、アリル基等の不飽和結合を有する単量 体およびNービニルピロリドンのようなウレタン の水素結合生成を阻止する単量体を一部混合して 用いることも可能である。

以上述べた構成成分の配合比率を (A) 重合体 100重量部、 (B) 重合体 2~180重量部、 (C) 化合物 5~300重量部の範囲内で用いられる。

(B) 重合体が2 重量部未満では、光硬化で 得られた被環材料の引張り弾性率が高く、外圧に ル (メタ) アクリレート、2-ヒドロキシー3ーフェニルオキシプロピル (メタ) アクリレート、ラウリルート、ブトキシエチル (メタ) アクリレート、ラウリル (メタ) アクリレート、ステアリル (メタ) アクリレート、ステアリル (メタ) アクリレート、2ーヒドロキシエチル (メタ) アクリレート、シクロへキシルアクリレート、プリンプリコールモノ (メタ) アクリレート 類、ポリプロピレングリコールモノアクリレート類、2ーヒドロキシブロピル (メタ) アクリレート、グリシジル (メタ) アクリレート、グリシジル (メタ) アクリレート 試性化合物は単独または2種以上を混合して用いられる。

また、多官能性化合物としては、 1.4-ブタンジオールジ (メタ) アクリレート、 1,6-ヘキサンジオールジ (メタ) アクリレート、ペンタエリスリトールトリ (メタ) アクリレート、トリメチロールプロバントリ (メタ) アクリレート、ネ

対する最低能力に欠けることとなる。逆に180 重量部を越えると、光硬化された被覆材料の表面 に粘着性が残り二次被覆(ナイロン・液晶ポリエ ステル等)の被覆作業に支限をきたす。

次に(C) 化合物の使用量が5 重量部未構の場合には被理用材料の粘度が高く、所望の厚みで均一に塗工することができない。一方、300重量部を越えると被覆材料の粘度が低く過ぎ、厚く塗工することができなく、また光硬化した被覆材料が染軟性と強靱性に欠けることになる。

本発明に用いられる (D) の光重合開始剤とは、特に限定するものではないが、例えば次のような化合物が挙げられる。 ベンゾフェノン、アセトフェノン、ベンゾイン、ベンゾインインブチエーテル、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインインプロピルエーテル、ベンゾインイソプチルエーテル、酢酸ベンゾイン、2-クロルベンゾフェノン、4-メトキシベンプフェノン、4.4'-ピスジメチルアミノベ

ンプフェノン、 4.4′ - ジメチルベンゾフェノン、 ベンジルジメチルケタール、2-クロロチオキサ ントン、4-プロムベンゾフェノン、 2,4ージメ チルチオキサントン、 2.2′ - ジイソプロピルチ オキサントン、1-ヒドロキシシクロヘキシルフ ェニルケトン、 2.2′. 4.4′-テトラクロルベ ンプフェノン、2-クロルー 4′ーメチルベンゾ フェノン、3-メチルベンゾフェノン、4-t-プチルベンゾフェノン、ベンジル酸、ジアセチル、 2.2-ジェトキシアセトフェノン、9.10-フェナ ントレンキノン、2-メチルアントラキノン、2 - エチルアントラキノン、2-t-プチルアント ラキノン、ジフェニルジスルフィッド、ジチオカ ーパメート、p-ニトロジフェニル、p-ニトロ アニリン、 2.4-ジニトロアニリン、p-ニトロ アセトアニリド、ピクラミド1-メトキシー4二 トロナフタレン、2-クロロー4-ニトロアニリ ンアンスラキノン、 1,2-ベンズアンスラキノン、 3-メチル-1-ジアザー 1.9-ペンズアンスロ

タノールアミン、トリエタノールアミン等の第 2 級あるいは第 3 級アミン等がある。

また、本発明に係る樹脂の熱的安定性を図るために公知の熱重合防止剤などを添加することができる。

この熱質合助止剤として、ジー t ープチルー p ー クレゾール、ハイドロキノンモノメチルエー テル、ピロガロール、キノン、ハイドロキノン、 t ープチルカテコール、ハイドロキノンモノベン ジルエーテル、メチルハイドロキノン、アミルキ ノン、フェノール、ハイドロキノンモノプロピル エーテル、フェノチアジン、ニトロベンゼン等が 挙げられる。

本発明の光学ガラスファイバ用被覆材料は、 前記(A)、(B)、(C)および(D)の光重 合開始剤の他に必要に応じて、フタル酸エステル、 リン酸エステル等の可塑剤やシリカ、クレー、カ オリン等の無機質充填剤、難燃剤、チクソトロピ ック付与剤、カップリング剤、着色剤、希釈剤な ン、 1.9-ベンズアンスロン、p-p'-テトラメチルジアミノベングフェノン、、N-メチルー2-ベングイルナフトチアゾリン、5-ニトロフルオレン、5-ニトロフセナフテン、N-アセチル-4-ニトロ-1-ナフチルアミン、1.2-ベンズアントラキノン、 1.9-ベンズアンスロン、2.4.6-トリフェニルビリリウム塩などである。

前記 (D) である光度合開始剤の使用量は、 前記の (A)、 (B) および (C) の総量に対し て0.01~20重量%である。、これらの光度合 開始剤は単独または2種以上併用して用いられる。

また、これらの光重合開始剤とアミン類など の少量の増感助剤を併用することも可能である。

このようなアミン類としては、ブチルアミン、 ヘキサメチレンジアミン、ジエチレントリアミン、 トリエチレンテトラミン、モノエタノールアミン 等の第1級アミン、ジエチルアミン、ジメチルア ニリン、ジメチルーパラートルイジン、ピリジン、 N, N'-ジメチルシクロヘキシルアミン、ジエ

ど補助的成分を所望により加えることもできる。 これらの補助的成分の添加量は(A)、(B) および (C) の総量 1 0 0 重量部に対し、0 ~ 2 0 0 重量部の範囲である。

本発明の光学ガラスファイバ用被覆材料は、 前記の(A)、(B)、(C)および(D)の光 重合開始剤と必要に応じて加える補助的成分より なり、これを用いて実際に光学ガラスファイバを 被攬するには、従来からの公知の方法に準じて行 えば良く、一般には紡糸工程に引き続き光学ガラ スファイバの表面に本発明の被覆材料を塗布した のち、紫外線電子線等を照射を行うことによって 重合硬化をさせれば良い。

本発明による被覆材料は光学ガラスファイバ 被費用として好適であるが、その他に各種コーティング剤、塗料、接着剤、インキ、含浸材あるい は電気路縁材などに利用することができる。 具体 的にはプリント基板の保護コーティング材、メッ キおよびソルダーレジスト材、モーター、電気コ ィルの絶縁材、液晶パネルの接着剤、光デスクの 接着剤、封止剤、コーキングおよびシーリング剤 などに用いられる。

(作用)

分子内に重合性不飽和結合を有する彼状ジェン系重合体を主成分とする被覆材料より、これに分子骨格中にエーテル結合、エステル結合を有よりなる群から選ばれた結合を有し、かつ分子内にケイ皮酸差を有する重合体を必須成分として配合することにより得られた光硬化被関材料の引張り弾性率が著しく低くな光学がラスである。これである。との数料を与えることができる。これはアクリロイル基(メタクリロイル基)等の光密応性二重結合とケイ皮酸基との紫外線(電子線)に対する硬化速度および機作に差がある。

この結果として被限材料は相互侵入網目構造 を形成する。これによって引張り弾性率の奢しく 低く、加熱雰囲気下での引張り弾性率の増大が抑

えた反応容器に132部の2.4ートリレンジイソシアナートと1.0部のジブチル器ジラウレートおよび3.0部のpーメトキシフェノールを仕込み、これにヒドロキシエチルアクリレート93部を乾燥空気気流中で2時間に亘って添加した。発熱反応で温度が上昇するが約70でになったなら、この温度を保持し、さらに1時間攪拌を続けた。

次に、これに1000部の水酸基合有液状ポリプタジエン(出光興産 poly bd R-45HT、水酸基含量0.8 meq/s 、数平均分子量2.800、トランス 1.4 60%、シス 1.4 20%、1.2 ビニル 20%)を3時間に亘って添加した。発熱反応で温度が上昇するが約70でになったなら、この温度に保持し、さらに2時間提供を続け、・(A) 重合体(A) - 1を得た。

合成例 A - 2. 3. 及び 4

第1表に示される如く、合成例A-1の 2.4
-トリレンジイソシアナートの代わりにピス (4
-イソシアナートシクロヘキシル) メタン、 1.4

制され、しかも弾性に富んだ強靭な光硬化被覆材料をうることができたものと考えられる。

本発明による光学ガラスファイバは、常温下では外圧による設街作用が強く、従って外圧によるでイクロベンデングによる光伝送損失を生ずることがない。

しかも分子骨格のジェン結合額による低いTa を保持し、かつ高温下での弾性率の増大を抑制し うることにより、低温・高温サイクル環境下に曝 されても優れた光伝送損失を保持することができ

(実施例)

次に、合成例、実施例および比較例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの例のみに限定されるものではない。なお、例中の部および外は重量部および重量%である。

合成例 A-1

(A) 薫合体の合成:

長神機、遺統冷却管および空気吹込み管を備

液状ポリプタジェンの代わりに 1.2-ポリプタジェンを使用し、また他の原料の使用量を選択し、合成例 A - 1 に準じて反応を行い (A) 重合体である (A) - 2. 3. 4 を得た。

合成例A-5

機拌機、分水器、運流冷却管、温度計を備えた反応容器に340部のカルボキシル基合有液状ポリブタジエン(出光興産 Hycar CIBN 1300×13、数平均分子量3.400、酸価33)と186部のエチレングリコール、550部のトルエン、0.4部のパラトルエンスルホン酸を仕込み、約110でで加熱運流下で脱水反応を行った。22時間の脱水反応で理論量の水を分取した。これを炭酸ソーダで中和水洗し、減圧下でトルエンの留去と脱水乾燥し、水酸基含有ポリブタジエン・アクリロニトリル共重合体グリコール(水酸基低31)を得た。

次に合成例A~1と同じ反応容器に43部の ピス(4~イソシアナートシクコへキシル)メタ

特開昭62-148346(8)

ンと0.3 部のジブチル錫ジラウレートおよび0.9 部のp-メトキシフェノールを仕込み、これにヒドロキシエチルアクリレート19部を乾燥空気気流中で2時間に亘って添加した。発熱反応で温度が上昇するが約70 でになったなら、この温度を保持し、さらに1時間微律を続けた。

これに300部の合成した水酸基合有ポリプタジェン・アクリロニトリル共重合体グリコール (水酸基価31)を3時間に亘って添加した。発 無反応で温度が上昇するが約70℃になったなら、この温度に保持し、さらに1時間覺拌を続け(A) 重合体(A) - 5を得た。

合成例 B-1

(B) 重合体の合成:

現辞機、温度計、還流冷却管を備えた反応容器に500部のポリプロピレンエーテルグリコール(数平均分子量1002、水酸基価112)、
100部のピリジンを仕込み、これに166部のケイ皮酸クロライドを3時間に亘って添加した。

えて良く 攪拌混合し、これに合成例 B-1で得られた (B) 重合体 (B) -1を70部加えて良く 健拌混合し、さらに (D) の光重合開始剤として 21部のペンジルジメチルケタールと4部の p- ニトロアセトアニリド (ケイ皮酸化合物の光重合開始剤) を添加し再び良く混合溶解した。この最終組成物を5ミクロンのフィルターを通した後、光学ガラスファイバ被覆用材料に供した。

(試料1)

寒游艇2~8

実施例』に準じて第3表の如く、本発明の被 関用材料(試料2~8)を調整した。尚、念のた め実施例1についても第3表に記載した。

比較例 1~5

比較例として实施例1に準じて第4表に記録の如く被覆用材料(試料C-1~C-5)を調整した。

発熱反応で温度が上昇するが約-60年になったな ら、この温度に保持し、さらに2時間撹拌を続け た。

次に、室温まで放冷した後10%の炭酸ソーダの水溶液にて洗浄し、未反応のケイ皮酸クロライドを除去し、次いで十分に水洗した。これを波圧下で脱水乾燥して(B) 重合体を合成した。

(試料(B)-1)

合成例 B - 2. 3及び 4

第2表に示される如く、合成例B-1のポリプロピレングリコールを積々に変え、また他の原料の添加量を変えて、合成例B-1に単じて反応させ(B) 重合体を合成した。(試料(B)-2.3及び4)。

実施例1

合成例A-1で得られた(A)重合体(A) -1の350部に(C)化合物であるフェノキシ エチルアクリレート280部および(D)の光重 合助剤として70部のN-ピニルピロリドンを加 第 1 表

(暗量部)

Γ	F	4	}	戍	54	
	原 料	A-1	A - 2	A - 3	A - 4	A - 5
ジイナ	2.4ートリレンジイソシアナート	139	ថា			
ソーア	ピス(4ーイソシアナート シクロヘキシル) メタン			101	210	43
被	(1) 1,4ーポリブタジエングリコール	1000			1000	
状ポリジ	(2) 1.2 -ポリプクジエングリコール		300	300		
エン	ポリプタジエン・ (3) アクリロニトリルグリコール					300
	ジブチル锅ラウレート	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3
	pーメトキシフェノール	3.0	0.9	0.9	3.0	0.9
	ヒドロキシエチルアクリレート	93	45	45	93	19
	(A) 重合物 (符号)	(A)-1	(A) - 2	(A) - 3	(A) - 4	(A) - 5
	分 子 量	3080	2139	2431	3256	4376

- 注(1) 数平均分子量 2800 、水酸基含有量 0.80emq/g (出光與產時 poly bd R-45TT)
 - (2) 数平均分子量 1450 、水酸基值 72 (当 社 製 NISSO PBG-1000)
 - (3) 数平均分子量 3488 、水酸基価 31 (字部與產% Hycar CTBN 出発原料)

第 2 表

(黄量部)

	合成 好				
原料	B - 1	B - 2	8 – 3	B - 4	
ポリプロピレン エーテルグリコール(1)	500				
ポリテトラメチレン エーテルグリコール(2)		500			
アジピン酸系 ポリエステルグリコール(3)			500		
水酸基含有液状 ポリプタジエン(4)			•	500	
ピリジン	87	127	122	35	
ケイ皮酸クロライド	166	242	171	67	
(B) である重合体 (符号)	(B) - 1	(B) - 2	(B) - 3	(B) - 4	
分子员	1.261	947	1.235	3,057	

注(1) 数平均分子量 1002、水酸基值 112.

(2) ~ 688 . ~ 163.

(3) ~ .976 ~ 115

(大日本インキ工業的製:ポリライト OD-X-240)

(4) 数平均分子量 2800 、水酸基含有量 0.80meq/q、

トランス 1.4:60%、シス 1.4:20%、1.2 ピニル:20%

(出光贝産67): poly bd R-45HT)

第 3 表

(重量部)

i e	原料		実		施		€	8 1	
	4-1	1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	重合物	(A)1 350	(A) - 2 350	(A) - 3 400	(A) - 4 400	(A) - 5 350	(A) - 6 350	(A) - 7 350	(A) - 8 350
(B)	重合物	(B) - 1 70	(B) - 2 70	(B) - 3 80	(B) - 4 80	(B) - 5 70	(B) - 6 70	(B) - 7 70	(B) - 8 70
(C)	フェノキシエチル アクリレート	280	280	320	320	280	280	280	280
(D) 光 重	ベンジルジメチル ケタール	21	. 21	24	24	21	21	21	21
D光重合開始剤	P-ニトロアセト アニリド	4	4	4	4	4	4	4	4
N-	ビニルピロリドン	70	70	80	80	70	70	70	70
被覆	用材料(裁判)	1	2	3	4	5	6	7	8

4	麦	(重量部)
	-	

	ŀ	Ł	62	64	
原 料	1	2	3	4	5
(4) 重合物	(A) - 1 350	(A) - 2 400	(W - 3 400	(A) - 4 350	(A) - 5 350
(C) フェノキシ エチルアクリレート	280	320	320	280	280
(B) ベンジルジメチルケタール	21	24	24	21	21
N-ビニルピロリドン	70	80	80	70	70
被厘用材料(以料)	C-1	C-2	C - 3	C-4	C - 5

试验例1

以上の如くして得られた実施例1~8、比較 例1~5の光学ガラスファイバ被覆用材料を用い て紫外線による硬化物シートを作成し、その引張 り強度弾性率を測定した。硬化物シートの作成方 法、引張り弾性率の測定方法について次に示す。 また得られた測定結果を実-5に示した。

< 試験法>

i) 被獲用材料の硬化およびシートの作製

実施例 1 ~ 8、比較例 1 ~ 5 の光学ガラスファイバ被理用材料をプリキ試験板上にドクタープレードを用いて厚さ0.1 mmに塗布する。

次いで、80W/cmのメタルハライドランプ、ランプ間距離40cmの紫外線硬化装置を用い10秒間照射して光硬化を行った。これを水銀アマルガム法によってハク艇し試験用シートを作製した。

ii) 弾性率の測定

i) 項の方法で得られた試験シートを20 t、50%RHの恒温室に24時間放設した後、JISK

特開昭62-148346 (11)

第 5 表

- 7113に単じて弾性率の測定を行った。

また、加熱老化は80℃の熱老化試験機中に 7日間加熱後の弾性率の測定を行った。

ii) ガラス転移温度

東洋ボールドウイン製の装置を用い、 周波数35 kk 昇温速度 2 セン分、 動的変位 ± 0、0 2 5 m 、 別定温度 - 1 0 0 セ ~ + 1 0 0 セの条件で測定し、 これよりガラス転移温度を測定した。

				4m)	•	引張り弾性部	ガラス転位	
			TA.	料	記号	常態	加熱老化	温度 (七)
	实施例	i	试	料	1	0.36	4.46	-
本	実施例	2	試	丰	2	0.31	4.37	
~	実施例	3	試	#4	3	0.75	21.5	
発	実施例	4	試	料	4	0.45	19.2	-55
_	実施例	5	贫	料	5	0.13	2.35	-60
明	実施例	6	拭	料	6	0.19	2.70	-60
84	実施例	7	战	料	7	0.28	1.18	-61
	実施例	8	試	料	8	0.18	2.16	-60
T	HASIN	1	試	料	C-1	15.3	97.3	11
比	比较例	2	試	料	C - 2	17.7	285	26
較	HARRI	3	試	料	C-3	25.4	147	25
	出规例	4	試	料	C-4	9.9	82.5	-61
61	比较别	5	試	料	C-6	8.5	47.5	8

試験例2

光ファイバ母材を加熱溶融して80m/分の 速度で線引した外径125μmの光学ガラスファ イバに実施例1~8の試料1~8の各被種材試料 を用いて被覆後の外径400μm厚に塗工した後、 80W/cmのメタルハライドランプを用いて繋外 線を照射して被覆ファイバを得た。

この得られた被覆光ファイバは被覆による伝送損失の変化は認められず、また-50℃~+60℃の温度範囲における伝送損失の変化は±0.05dB/kg以下であった。

(発明の効果)

以上の説明から明らかなように、本発明は分子内に重合性不飽和結合を有する彼状ジェン系重合体を主成分とする被覆材料より、これに分子骨格中にエーテル結合、エステル結合およびジェン結合よりなる群から選ばれた結合を有し、かつ分子内にケイ皮酸基を有する重合体を必須成分として配合することにより、光学ガラスファイバ用被

複材料の硬化後の引張り弾性率を楽しく低下させることができ、しかも硬化物のガラス転位点がいずれも-60℃以下と低く、このため低温下での引張り弾性率も低い。また高温に晒されることにより引張り弾性率の増大も考しく小さくなる。

これより低温・高温サイクル環境下での光学ファイバの使用においても柔軟性と可認性を保持し、しかも低い引張り弾性率により光学ガラスファイバの側圧および熱収縮に対して優れた緩和能力を発躍し、マイクロベンデング等による光伝送損失の増加を防止することができる。勿論本発明の液状樹脂被覆材料は、低粘度で高速作業性に適し、石英ファイバとの密着性を有し、耐水、耐湿透過性が極めて小さく光学ガラスファイバ被預用材料として好適で、かつ巾広い分野で有効に利用することができる。

出願人(430) 日本曾連株式会社 代理人 弁理士 伊 廢 晴 之

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.